

论文

引用本文: 梁仁荣, 王敬, 徐阳, 许军, 李志坚 : 多层复合结构应变硅材料的生长和特性., 材料研究学报, 2007, 1, 0

梁仁荣 王敬 徐阳 许军 李志坚

摘要:

应用减压化学气相沉积技术,在弛豫Si_{0.7}Ge_{0.3}层/组分渐变Si_{1-x}Gex层/Si衬底这一多层复合结构的基础上制作了应变硅材料,其中组分渐变Si_{1-x}Gex层Ge的摩尔分数x从0线性增加到0.2.对该复合结构的性能进行了表征,由原子力显微镜和Raman光谱测试结果计算出应变硅层的表面粗糙度和应变度分别为4.12 nm和1.2%,材料中的位错密度为4×10⁴cm⁻².经受了高热开闸过程后,应变硅层的应变度及其表面形貌基本上保持不变.

关键词:

Abstract:

Keywords:

收稿日期 1900-01-01 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期 2007-02-25

DOI:

基金项目:

通讯作者: Email:

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 3997
<input type="text"/>			

扩展功能

本文信息

Supporting info

PDF (546KB)

[HTML全文]

参考文献

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

本文作者相关文章

▶ 梁仁荣

▶ 王敬

▶ 徐阳

▶ 许军

▶ 李志坚

PubMed

Article by

Article by

Article by

Article by

Article by